

利用課題番号 : F-13-WS-0072  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名 (日本語) : 石英基板のハイアスペクト加工検討  
Program Title (English) : High aspect ratio fabrication of quartz substrates  
利用者名 (日本語) : 高山 公介  
Username (English) : Kosuke Takayama  
所属名 (日本語) : 旭硝子株式会社  
Affiliation (English) : Asahi Glass Co., Ltd.

1. 概要 (Summary) :

フォトリジストをエッチング用マスク材として、アスペクト比が高く、形状が制御された構造体を、石英基板表面に形成する方法等について相談した。

それは、ウェットによるエッチング、イオンによるドライエッチング及び、プラズマ加工を提案し、各技術の全ての課題を挙げて、可能性について相談を行った。

2. 実験 (Experimental) :

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

4. その他・特記事項 (Others) :

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし。

6. 関連特許 (Patent) :

なし。